



CINOS CLEANING TECHNOLOGY

Chemical Assisted Ultra Sonic

CAUS™

CAUS™는 다수의 미세한 홀 내부의 파티클 세정을 위한 전용 세정 장치입니다. 반도체 공정에서 사용되는 부품의 홀 내부는 약액(세정액)과 모재의 표면 장력 등에 의해 세정액이 홀 내부로의 침투가 원활하지 않게 됩니다. 그렇기 때문에 일반적인 침적 방식의 세정은 파티클을 완벽히 제거 불가능하고, 챔버 장착 시 다량의 파티클들이 발생합니다.

CAUS™는 표면 에너지를 개선한 전용 약액(세정액)과 약액의 활성화와 주입을 향상시키고, 약액의 캐비테이션(Cavitation) 효과를 발생시키는 초음파를 적용한 기술로 홀 내부에 잔존하는 공정상 발생하는 반응 부산물 등의 파티클을 효과적으로 제거할 수 있습니다.

 **Point**

 Cavitation

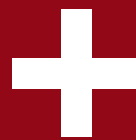
 Minimize Variation

 Reactivity

CINOS

CAUS™
처리전/후
13 μm
증가
변화 최소화

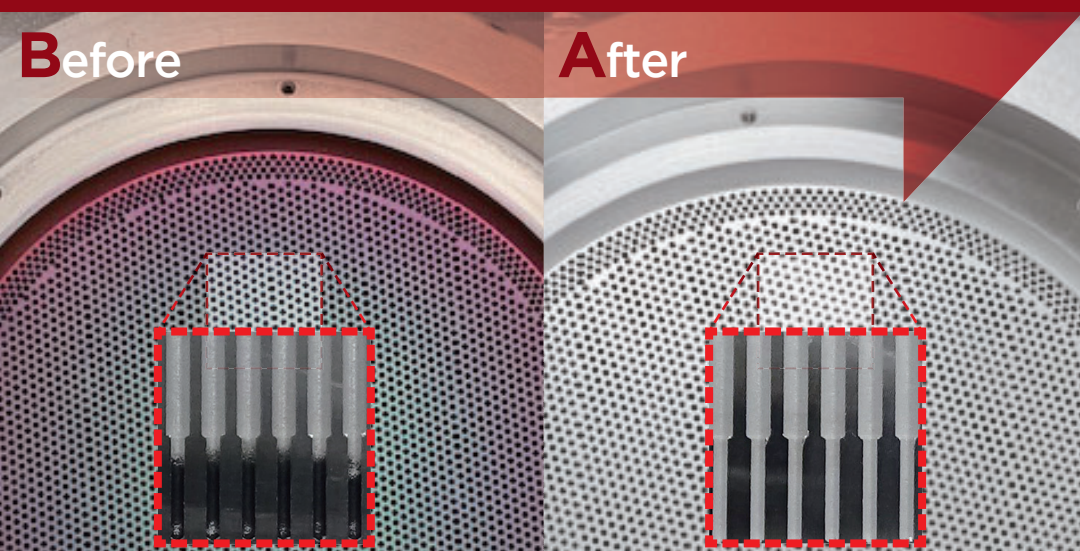
Cleaning Liquid



Ultrasonic wave



약액의 케비테이션(Cavitation)효과를 발생시키는 초음파로
홀 내부에 잔존하는 막질을 효과적으로 제거할 수 있습니다.



**Best Solution
For Hole
Type**



CAUS™는 Hole 전 제품
처리 가능한 기술입니다.

CINOS CAUS™ Driving Appearance

CINOS

C1 경기도 화성시 팔탄면 삼천병마로 517-19 C2 경기도 화성시 향남읍 발안공단로209 C3 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 98-17
Tel. 031.366.3390 Fax. 031.366.3394 Web. www.cinoseng.com Copyright by CINOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.